

# EUV CAR-NTD レジスト / 現像液

## 技術・製品の概要説明

### EUVレジスト PCP技術

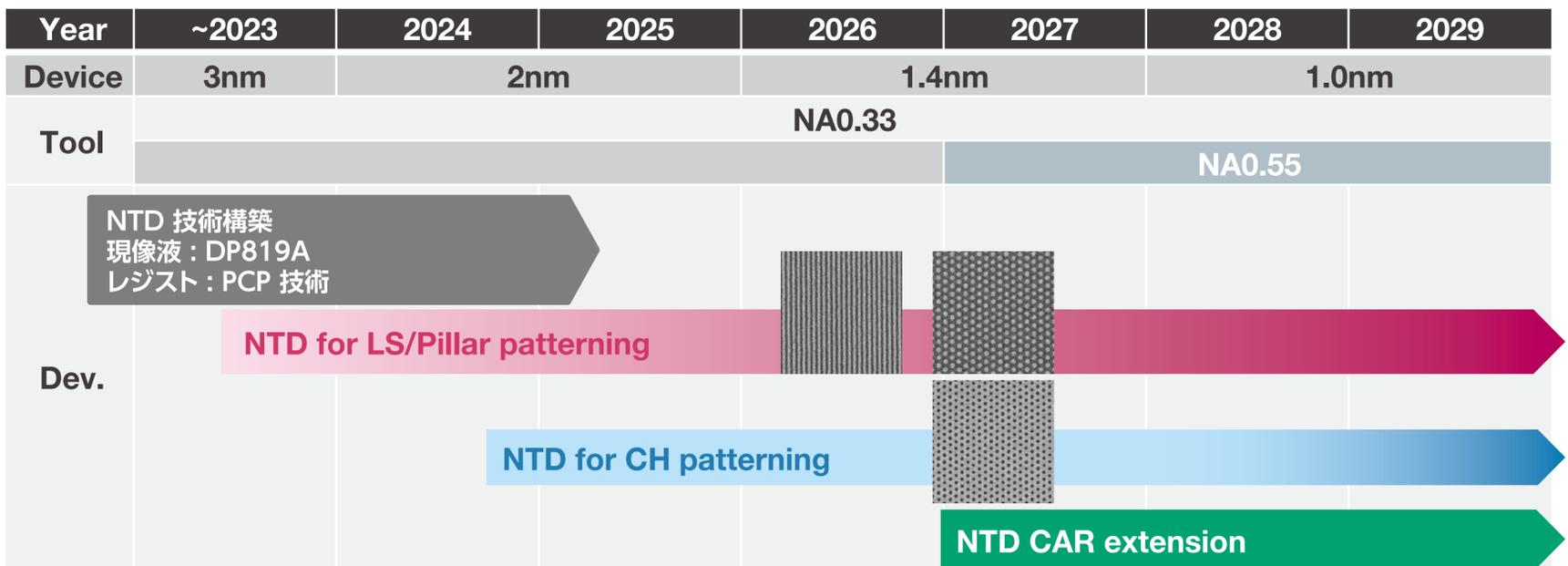
膜中の分子の均一分布

レジストの反応制御機能を持つ光分解性クエンチャー連結型光酸発生剤（PCP）を導入。露光時の膜中の酸濃度を均一に保つことで、従来の化学増幅型レジストの課題であったLWRを低減。

### 新規NTD現像液 DP819A

高純度有機溶剤を用いた NTD 現像液で現像時のレジストの膨潤と欠陥を抑え、高いパターンニング精度を実現。

## FUJIFILM EUV CAR-NTD ロードマップ



ArF 開発で培った NTD プロセスを EUV 向けに進化させ、EUV レジストと EUV 現像液を組み合わせ最適化。

## EUV CAR-NTD レジスト性能 (DP819A 現像液)

